SEARCH:

Submit Query

GO TO ADVANCED SEARCH LOGGED IN AS:

- JASON LEE DE FRANCESCO
- Logout
- HOME
- SEARCH PATENTS
- CHEMICAL SEARCH
- DATA SERVICES
- HELP
- My Account
- My Portfolios
- My Alerts
- My Saved Searches
- Invite a Friend

Portfolio:

Add to portfolio Choose or add to a new portfolio, named

Go

Title:

AGENT FOR INHIBITING TYROSINASE ACTIVITY

Document Type and Number: Japanese Patent JP06100433 Kind Code:

A Abstract:

PURPOSE: To provide a tyrosinase activity inhibiting Inventors: agent having high tyrosinase activity inhibiting effect, Miura, Yasutaka

high chemical stability and low toxicity and useful as Kinoshita, Yasuhiro a melanogenesis inhibiting agent.

CONSTITUTION: A tyrosinase activity inhibiting agent expressed by formula I (R1 is H, 1-9C alkyl or 1-9C alkenyl), formula II (R2 is 2-9C alkyl or 2-9C alkenyl) or formula III (R3 and R4 are H, 1-9C alkyl JP1993000194666 or 1-9C alkenyl), especially 6,6'-di-n-propyl-2,2',4,4'- Publication Date: tetrahydroxydiphenylmethane. The tyrosinase activity 04/12/1994 inhibiting agent has low toxicity and stimulation to the skin and high stability to light, heat, various cosmetic bases and additives and is usable in combination with these cosmetic bases, additives, etc. View patents that cite this patent

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio

Yamamoto, Yoshikazu Takahashi, Kunio Koyama, Kiyotaka

Kinoshita, Kaoru Application Number: Filing Date: 08/05/1993 Referenced by:

Export Citation:

Click for automatic bibliography generation

Assignee:

NIPPON PAINT CO LTD

International Classes:

(IPC1-7): A61K7/48; //A23K1/16; A61K7/00; A61K31/05; A61K31/05

39:48 on millowate

Copyright 2004-2009 FreePatentsOnline.com. All rights reserved. Privacy Policy & Terms of Use.

- Home Search Patents Data Services
- <u>Help</u>
- Contact usAdvertise on this Site

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

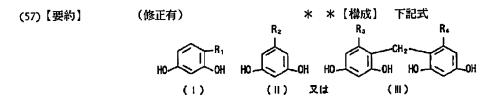
(11)特許出願公開番号

特開平6-100433

(43)公開日 平成6年(1994)4月12日

(51)Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示協所
A 6 1 K 7/48		9051-4C		
7/00	C	9164-4C		
	X	9164-4C		
31/05	ADD	9283-4C		
	AED	9283-4C		
			審査請求 未請求	: 請求項の数5(全6頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特顧平5-194666		(71)出願人	000230054
				日本ペイント株式会社
(22)出願日	平成5年(1993)8月	15 B		大阪府大阪市北区大淀北2丁目1番2号
			(72)発明者	三浦 靖▲高▼
(31)優先権主張番号	特願平4-208808			大阪府寝屋川市池田中町19番17号 日本ペ
(32)優先日	平4(1992)8月5日	3		イント株式会社内
(33)優先権主張因	日本(JP)		(72)発明者	木下 靖浩
				大阪府寝屋川市池田中町19番17号 日本ペ
				イント株式会社内
			(72)発明者	山本 好和
				大阪府寝屋川市池田中町19番17号 日本ペ
				イント株式会社内
			(74)代理人	弁理士 青山 葆 (外2名)
				最終頁に続く

(54)【発明の名称】 チロシナーゼ活性阻害剤



[式中、R、R、R、およびR、は水素原子または炭素数 $1\sim9$ のアルキル基もしくはアルケニル基であり、R、は炭素数 $2\sim9$ のアルキル基もしくはアルケニル基である。] で示す構造を有するチロシナーゼ活性阻害剤。

【効果】 上記化合物はチロシナーゼ活性阻害効果が高く、化学的に安定でしかも毒性が低いチロシナーゼ活性 阻害剤である。

【特許訥求の範囲】 【韵求項1】 式

【化1】

ř

[式中、R₁は水素原子または1~9個の炭素原子を有す るアルキル基もしくはアルケニル基である。〕で示す樹 10 造を有するチロシナーゼ活性阻害剤。

【翻求項2】 式

【化2】

[式中、R.は2~9個の炭素原子を有するアルキル基も しくはアルケニル基である。] で示す構造を有するチロ シナーゼ活性阻害剤。

【請求項3】 式

【化3】

[式中、R,およびR,は水素原子または1~9個の炭素原 子を有するアルキル基もしくはアルケニル基である。] で示す構造を有するチロシナーゼ活性阻害剤。

【訥求項4】 前記R, およびR, がプロピル基である、 請 求項3記載のチロシナーゼ活性阻害剤。

【請求項5】 6.6'-ジ-n-プロピル-2,2'4,4'-テトラハ米

$$R_1$$
 R_1
 R_1
 R_2
 R_1
 R_2
 R_1
 R_2
 R_2
 R_3
 R_4
 R_4
 R_5
 R_5
 R_7
 R_7

【0007】[式中、R、R、およびR、は水素原子または 炭素数1~9のアルキル基もしくはアルケニル基であ り、Rは炭素数2~9のアルキル基もしくはアルケニル 基である。] で示す構造を有するチロシナーゼ活性阻害 剤を提供するものであり、そのことにより上記目的が達 成される。

【0008】好ましくは、本発明のチロシナーゼ活性阻 害剤は、式(III)で示す化合物の群から選択される少な

* イドロジフェニルメタン。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、腐美白化粧品、船底塗 料用防汚物質および昆虫等によるのメラニン生成阻害剤 に有用なチロシナーゼ活性阻害剤に関する。

[0002]

【従来の技術】従来よりチロシナーゼ活性阻害剤として いくつかのフェノール性化合物が知られており、そのい くつかは府美白化粧品等の用途に用いられている。しか しながら、これらには人体に対する安全性、化学的安定 性および有効性に問題を有するものが多い。

【0003】現在、チロシナーゼ活性阻害剤としてはハ イドロキノン類および4位に長鎖のアルキル基を有する レゾルシノール類等が知られているが、例えば、特開昭 61-21007号、同61-21008号、同61-21009号、同61-21010 号、同61-21011号および同61-21012号公報等に記載のハ イドロキノンのチロシナーゼ活性阻害様式は不拮抗剤で あり、生体内の恒常性維持の観点からみると、生体への のレゾルシノールタイプのチロシナーゼ活性阻害剤は4 付のアルキル鎖が長いので、水に対する溶解性に劣り、 **通常の化粧料に良好に用いることができない。そして、** 従来から用いられているアルブチンには毒性がある。ま た、特開平4-169515号公報に記載のトラネキサム酸はチ ロシナーゼ活性阻害効果が低いという問題を有する。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記従来の 問題を解決するものであり、その目的とするところは、 30 チロシナーゼ活性阻害効果が高く、化学的に安定でしか も毒性が低いチロシナーゼ活性阻害剤を得ることにあ る。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、式 [0006]

【化4】

くとも1種であり、さらに好ましくは、式 [0009]

[{£5]

50

1

3

【0010】で示す構造を有するチロシナーゼ活性阻害 剤である。

【0011】上記(I)、(II)及び(III)の式で示す構造を有する化合物を得る方法は特に限定されない。これらの化合物を当業者に周知の方法により合成してもよい。例えば、それぞれ以下の方法により合成することができる。

【0012】(I)の製造方法

まず、アルキルカルボン酸とレゾルシノールとを反応させることにより2,4-ジハイドロキシアルキルフェノンを 10 得る。次に、これを亜鉛と塩化第2水銀とにより得られる亜鉛アマルガムを用いて還元することにより4-アルキルレゾルシノールが得られる。

【0013】(II)の製造方法

まず、1,3-ジメトキシ-5-ベンゾイルクロライドとアルキルマグネシウムブロマイドとを反応させることにより1,3-ジメトキシ-アルキルフェノンを得る。次いで、これを亜鉛と塩化第2水銀とにより得られる亜鉛アマルガムを用いて還元する。さらに10から15ccの濃塩酸を1時間ごとに添加することにより反応を促進させる。反応終20了後冷却後、周知の方法で精製を行うことにより5-アルキルレゾルシノールが得られる。

【0014】(III)の製造方法

まず、1,3-ジメトキシ-5-アルキルベンゼン、フェノキシアセチルクロライド及びアルミニウムクロライドを反応させることにより6,6'-ジアルキル-2,2',4,4'-テトラメトキシジフェニルメタンを得る。これを周知の方法で加水分解することにより6,6'-ジアルキル-2,2',4,4'-テトラハイドロキシジフェニルメタンが得られる。

【0015】本発明のチロシナーゼ活性阻害剤を化粧料 に用いる場合は、式(I)、(II)及び(III)で示される少な くとも1種の化合物を選択して混合し、化粧料によく利 用される基剤(例えば、オリーブ油およびミンク油のよ うな油脂類、ラノリンおよび蜜ロウのようなワックス、 ワセリンおよびスクワランのような炭化価水素類、パル ミチン酸イソプロビルのようなエステル類、セチルアル コールおよびラウリルアルコールのような高級アルコー ル類、ステアリン酸およびパルミチン酸のような高級脂 肪酸、コレステロールのようなステロール類)およびア ルコール類(例えば、エタノール、イソプロピルアルコ ールおよびプロピレングリコール)などに溶解もしくは 分散させて各種の化粧料(例えば、クリーム、乳液、化 粧水液、バックおよび洗顔料のような各種基礎化粧料、 ファンデーション、ほほ紅、ブラッシャーおよびリップ スチックのような各種メーキャップ料、および石鹸、シ ャンプー、リンス、香水およびオーデコロンその他の化 粧料)に広範囲に適用できる。この場合に、各種化粧品 添加剤(例えば、各種界面活性剤、溶剤、色素、香料、 防腐剤、抗酸化剤、保湿剤、ビタミンおよび動植物抽出 物その他の添加剤)とも併用できる。また、前記各種化

粧料の形状は、溶液、エマルジョン、軟膏、オイル、ワックス、ゲル、ゾル、粉末およびスプレー等の各種形状で適用することができる。

【0016】チロシナーゼ活性阻害剤の各種化粧料中への配合量は、その使用形態により適宜選択・変化させることができる。原則的には、有効量存在させればよい。一般的には化粧料組成物中(総重量に対して)0.001~20重量%、好ましくは0.01~5重量%配合するのがよい。【0017】本発明のチロシナーゼ活性阻害剤は、皮膚に対する毒性及び刺激性が低く、光および熱に対する安定性が高く、さらには各種化粧基材および添加剤に対する安定性も高く、これらの各種化粧品基材、添加剤等とも併用することができる。

[0018]

【実施例】以下の実施例により本発明をさらに詳細に説明するが本発明はこれらに限定されない。

[0019]

【合成例1】

4エチルレゾルシノールの合成

162qの酪酸に151qの塩化亜鉛を溶解した。次に110gのレゾルシノールを加え150°Cで20分間反応させた。反応後2 50m1の濃塩酸と250m1の水を加え、冷却後、常法により精製して化合物2,4-ジハイドロキシエチルフェノン100qを得た。次に400qの亜鉛と20qの塩化第2水銀により得た亜鉛アマルガムに300ccの水、300ccの濃塩酸及び100qの2,4-ジハイドロキシエチルフェノンを加え、還元した。さらに10から15ccの濃塩酸を1時間ごとに添加した。反応終了後冷却後、反応液を塩化ナトリウムで飽和し、エーテルで抽出し、88qの4-エチルレゾルシノールを得た。

[0020]

【合成例2】

5-メチルレゾルシノールの合成

100qの1,3-ジメトキシ-5-ベンゾイルクロライドに35qのメチルマグネシウムブロマイドを加えることにより45%の収率で1,3-ジメトキシ-メチルフェノンを得た。次に400qの亜鉛と20qの塩化第2水銀により得た亜鉛アマルガムに300ccの水、300ccの濃塩酸及び100qの1,3-ジメトキシ-メチルフェノンを加え、還元した。さらに10から15c40 での濃塩酸を1時間ごとに添加した。反応終了後冷却後、反応液を塩化ナトリウムで飽和し、エーテルで抽出し、40qの1,3-ジメトキシ-5-メチルベンゼンを得た。得られた1,3-ジメトキシ-5-メチルベンゼンにヨウ化水素を加えて窒素置換下、115~125°Cで3時間攪拌し、冷却後塩化メチレンで抽出し、30qの5-メチルレゾルシノールを得た。

[0021]

【合成例3】

6,6'-ジ-n-プロビル-2,2',4,4'-テトラハイドロキシジ 50 フェニルメタンの合成

5

70m1のベンゼンに11qの1,3-ジメトキシ-5-プロビルベンゼン、11qフェノキシアセチルクロライド及び9 qのアルミニウムクロライドを加え、5°Cで1.5時間投拌した。 水冷下で塩酸で加水分解後、エーテルで抽出し、6,6'-ジ-n-プロビル-2,2',3,3'-テトラメトキシジフェニルメタン0.3qを得た。得られた6,6'-ジ-n-プロビル-2,2',4,4'-テトラメトキシジフェニルメタンにヨウ化水素を加えて115~125'Cで3時間撹拌し、冷却後塩化メチレンで抽出し、0.3qの6,6'-ジ-n-プロビル-2,2',4,4'-テトラハイドロキシジフェニルメタンを得た。得られた化合物 10の'H-NMRと''C-NMRチャート図をそれぞれ図1および図2に示す。

[0022]

【実施例】

合成例1~3で得られたチロシナーゼ活性阻害剤および 合成例1~3と同様の方法で得られた表2に示された他 の阻害剤(特許請求の範囲内および範囲外(対照)の化 合物)のチロシナーゼ活性阻害率の測定 以下の方法により測定を行った。

(1)反応系試薬

反応系試薬として使用したものは以下の通りである。

基質 :2 mM L-ドーパ(和光純菜)

級衝液:0.1M リン酸-カリウム(pH6.8)溶液

阻害剤:式(I)で示される化合物、4-エチルレゾルシノール;式(II)で示される化合物、5-メチルレゾルシノール; 式(III)で示される化合物、6,6'-ジ-n-プロピル-2,2',-* * 4,4'-テトラハイドロキシジフェニルメタン; 各1%溶液

酵素:チロシナーゼ(Sigma社) 0.5mg/ml

【0023】(2)チロシナーゼ活性阻害率の測定 反応液の調製

チロシナーゼ活性の測定に際して、次の表 1 に示した割合で混合したNo.1、No.2およびNo.3の試料溶液をそれぞれ分光光度計セル(1 ml)に調製した。

【表 1 】

試料溶液の組成(回1)

	No. 1	No. 2	No. 3
製衝液	0.50	0.50	0.50
基質	_	0.20	0.20
阻害剤	_	_	0.10
イオン交換水	0.48	0. 28	0, 18

測定

セルに酵素溶液(0.20ml)を加え、添加時より3分後から471nmの吸光度を分光光度計で経時的に測定した。No.2の吸光度(Ab.2)の最大値を示す時間でのNo.3の吸光度(A 20 b.3)およびNo.1の吸光度(Ab.1)を下記式に当てはめて阻害率を計算した。IC,,(チロシナーゼ活性阻害率50%の時のチロシナーゼ活性阻害剤の濃度)を表2に示す。阻害率(%)={1-(Ab.3-Ab.1/Ab.2-Ab.1)}×100 [表2]

HW. 010 -2 -11-2 12 22 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12					
R	HO OH	НО ОН			
メチル	8 µ M	5000µM (対照)			
エチル	2 μ Μ	700µM			
n-プロピル	0.9 # M	500µM			
n-ペンチル	0.8µM	200µM			
n-ヘプチル	0.7μM	200µM			
n - ノ = ル	0.9µM	200 µ M			
合成例3 の化合物	2 5	μ M			

[0024]

【発明の効果】チロシナーゼ活性阻害効果が高く、化学 的に安定でしかも毒性が低いチロシナーゼ活性阻害剤が 提供された。

【図面の簡単な説明】

【図1】 合成例3で得られた化合物の'H-NMRチャート。

50 【図2】 合成例3で得られた化合物いC-NMRチャ

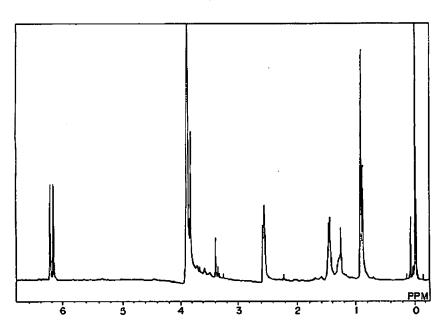
(5) 特開平6-100433

7

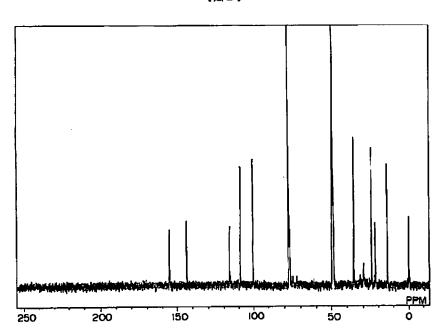
ート。

ï

【図1】



【図2】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.'
// A 2 3 K 1/16

識別記号 庁内整理番号 301 B 9123-2B ΓI

技術表示箇所

(72)発明者 ▲高▼橋 邦夫 埼玉県浦和市本太2-23-6

f · · · •

(72)発明者 小山 滸隆 東京都東久留米市中央町4-2-24

(72)発明者 木下 薫 東京都東久留米市学園町 l - 11-22-201